

H05H プラズマ技術（イオンビーム管 H01J27/00; 電磁流体発電機 H02K44/08; プラズマの発生を含む X 線の発生 H05G2/00）; 加速された荷電粒子のまたは中性子の発生（放射線源から中性子を得るもの G21, 例 .G21B,G21C,G21G）; 中性分子または原子ビームの発生または加速（原子時計 G04F5/14; 誘導放出を用いる装置 H01S; 分子, 原子, または原子より小さい粒子のエネルギー - レベルによって決められた基準周波数との比較による周波数調整 H03L7/26）

# 注

- (1) このサブクラスは、以下のものを包含する：  
 (a) プラズマの発生または取扱い;  
 (b) サブクラス H01J に含まれない装置であって、電子、イオンビームまたは中性粒子を高エネルギーに加速する装置;  
 (c) 中性粒子ビームを発生させるための装置 [3]  
 (d) (a), (b), または (c) のためのタ - ゲット [3]  
 (2) サブクラス G21K に注意すること。 [3]

## サブクラス内の索引

プラズマ技術.....	1/00
中性粒子ビームの発生と加速.....	3/00
核反応を起すためのタ - ゲット.....	6/00
粒子加速器	
直流電圧型加速器; 単一パルスを用いる加速器	5/00
線型; 磁気誘導型; 磁気共振型.....	9/00;11/00;13/00
その他.....	15/00
細部.....	7/00
1/00	プラズマの生成; プラズマの取扱い (熱核融合炉へのプラズマ技術の応用 G21B1/00)
A	プラズマ診断, 計測に関するもの
Z	その他のもの
1/02	・電界または磁界あるいはそれらによってプラズマを閉じ込めるための装置; プラズマを加熱するための装置 (電子光学 H01J)
1/03	・静電界を用いるもの [3]
1/04	・プラズマ中の放電によって発生する磁界を用いるもの
1/06	・直線ピンチプラズマ発生装置
1/08	・誘導ピンチ (ピンチ) プラズマ発生装置
1/10	・磁界のみを用いるもの
1/11	・カスプ配位を用いるもの (H05H1/14 が優先) [3]
1/12	・閉ル - プ形状の容器を用いるもの, 例 . ステラレイタ
1/14	・容器が直線状で磁気鏡をもつもの
1/16	・電界と磁界を用いるもの
1/18	・超高周波, 例 . マイクロ波領域, の振動電界および磁界を用いるもの
1/20	・オ - ム加熱
1/22	・入射加熱のためのもの
1/24	・プラズマの発生 [2]
1/26	・プラズマト - チ [2]
1/28	・冷却装置 [3]
1/30	・電磁界を用いるもの, 例 . 高周波またはマイクロ波エネルギー - (H05H1/28 が優先) [3]
1/32	・ア - クを用いるもの (H05H1/28 が優先) [3]
1/34	・細部, 例 . 電極, ノズル [3]

1/36	・回路装置 (H05H1/38,H05H1/40 が優先) [3]
1/38	・電極の案内またはセンタリング [3]
1/40	・磁界を用いるもの, 例 . ア - クを集束または回転させるためのもの [3]
1/42	・プラズマ中に材料, 例 . 粉末, 液体, を導入するための設備を有するもの (静電噴霧, 噴霧を電氣的に荷電するための手段を有する装置 B05B5/00) [3]
1/44	・複数のト - チを用いるもの [3]
1/46	・電磁界を用いるもの, 例 . 高周波またはマイクロ波エネルギー - (H05H1/26 が優先) [3]
A	プラズマ処理装置
B	・マイクロ波プラズマ
C	・サイクロトロン共鳴 (ECR,ICR) を利用するもの
L	・高周波コイル型
M	・平行平板型
R	電気回路
Z	その他のもの
1/48	・ア - クを用いるもの (H05H1/26 が優先) [3]
1/50	・そして磁界を用いるもの, 例 . ア - クを集束または回転させるためのもの [3]
1/52	・イクスプロウディングワイヤまたはスパ - クギャップを用いるもの (H05H1/26 が優先; スパ - クギャップ一般 H01T) [3]
1/54	・プラズマの加速 [3]
3/00	中性粒子ビーム, 例 . 分子または原子ビームの発生または加速 [3]
3/02	・分子ビームまたは原子ビームの発生, 例 . 共振ビーム発生 (ガスメ - ザ H01S1/06) [3]
3/04	・電磁波圧力による加速 [3]
3/06	・中性粒子ビームを発生するもの (核反応を起こすためのタ - ゲット H05H6/00; 中性子源 G21G4/02) [5]
5/00	直流電圧型加速器; 単一パルスを用いる加速器 (H05H3/06 が優先) [5]
5/02	・細部 (核反応を起こすためのタ - ゲット H05H6/00) [3]
A	電源装置
B	付属装置
C	ビーム電流制御
Z	その他のもの
5/03	・加速管 (容器表面に改良されたポテンシャル分布を有する放電管のうづわまたは容器 H01J5/06; うづわまたは容器に組み合わされた X 線管の遮へい H01J35/16) [4]
5/04	・静電発電機により, 例 . バンドグラフ発電機により, 加速されるもの [4]
5/06	・タンデム型加速器; 多段型加速器
5/08	・昇圧トランス, 例 . 共振トランス, を使用する粒子加速器 [4]
6/00	核反応を起こすためのタ - ゲット (照射されるタ - ゲットまたは物体の支持具 G21K5/08) [3]
7/00	グル - プ H05H9/00-H05H13/00 によって包含される型の装置の細部 (核反応を起こすためのタ - ゲット H05H6/00) [3]

- 
- 7/02      ・高周波エネルギーを供給するための回路  
および方式（高周波発生器 H03B）
  - 7/04      ・磁石装置；磁石装置の励磁
  - 7/06      ・2 ビ - ム装置；多ビ - ム装置
  - 7/08      ・粒子を軌道に入射させるための装置
  - 7/10      ・粒子を軌道から放出させるための装置
  
  - 7/12      ・ビ - ムの最終エネルギーを変更させる装  
置
  - 7/14      ・真空室（H05H5/03 が優先）[4]
  - 7/16      ・導波管型のもの [4]
  - 7/18      ・空胴；共振器 [4]
  - 7/20      ・超電導壁を有するもの [4]
  - 7/22      ・線型加速器の細部，例．ドリフト管  
（H05H7/02-H05H7/20 が優先）[4]
  - 9/00      線形加速器（H05H11/00 が優先）
    - A    線形加速器一般
    - B    加速部構造
    - C    強度・エネルギー - 制御
    - D    周波数制御
    - E    冷却
    - F    細部
    - Z    その他
  - 9/02      ・進行波型線形加速器
  - 9/04      ・定在波型線形加速器
  - 11/00     磁気誘導型加速器，例．ベ - タترون
  - 11/02     ・空心型ベ - タترون
  - 11/04     ・偏倚型ベ - タترون
  - 13/00     磁気共振型加速器；サイクロトロン
  - 13/02     ・シンクロサイクロトロン，例．FM サイ  
クロトロン
  - 13/04     ・シンクロトロン
    - B    加速器（蓄積装置）各部の構成に特  
徴を有するもの
    - C    ・空洞、真空容器、真空のための構成  
（ポンプ・排気系）
    - D    ・高周波空洞
    - E    ・磁石装置
    - F    ・ウイグラ、アンジュレ - タ
    - G    ・入出射、入射器、出射器
    - H    ・冷却
    - M    制御、計装、測定に特徴を有するも  
の
    - N    ・運転方法、励磁方法
    - P    ・周波数同調、チューナ、結合率
    - Q    ・軌道（安定化・変位・波動運動）
    - R    ・測定手段、測定方法
    - S    各構成要素の配置、複数の加速器の  
組み合わせ
    - U    放射光の取扱い、露光のための構成  
（ミラ - 、アブソ - バ）
    - Z    その他のもの
  - 13/06     ・空心型磁気共振型加速器
  - 13/08     ・AG 磁気共振型加速器
  - 13/10     ・荷電粒子を最初の加速部に平行な軌道  
に戻すための 1 つまたは複数の線型加  
速部および湾曲磁石または類似のもの  
から成る加速器，例．マイクロトロン [4  
]
  - 15/00     荷電粒子の他に分類されない加速方法ま  
たは装置 [4]
-